

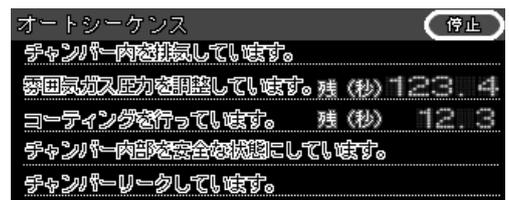


HPC-20 型

オスミウムコーター

ホローカソードプラズマCVD

- ◆ SEMで観察する試料のチャージアップを容易に防止可能です。
- ◆ 操作性・安全性・再現性・耐久性を徹底的に追及したモデルです。
- ◆ 操作はタッチパネルで行い、プログラム制御により操作ミスが起こりません。
- ◆ マニュアル操作時はタッチパネルに操作ガイダンスを表示します。
- ◆ 複雑な形状の生物や無機化合物などの試料を観察可能にします。
- ◆ どのような試料にも極めて薄いコーティングで導電性を与えることができます。
- ◆ 披着したオスミウム粒子は金や白金のように結晶化による粒子成長がなく、超高倍率観察(×800k)にも十分満足な画質が得られます。
- ◆ 真空チャンバー内部で四酸化オスミウムのアンプルを割断可能な機構を標準付属。全てのパーツに四酸化オスミウムで劣化し難い素材を採用して、取外しが不要です。
- ◆ 専用の真空ポンプとカートリッジ式排出オスミウムトラップを付属します。
- ◆ ピラニ真空計は簡易校正機能付き。交換用センサー1本付属。センサー交換をお客様が簡単に行う事が出来ます。
- ◆ あらゆる機能が充実(空気置換リーク、OsO₄ 温度・圧力自動調整、各種使用時間表示 etc.)



株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5

Tel: 029-212-7600 Fax: 029-212-7601

E-mail: device@shinkuu.co.jp

特徴・仕様

特徴

- ★ ホローカソード試料台による低電圧放電 CVD 法(特許)を採用、試料にやさしく金属オスミウムをコーティングします。
- ★ ホローカソード円筒内全体にオスミウムプラズマイオンが発生しますので試料の大きさ、高さの影響を受けません。
- ★ プラズマ放電に最適な真空度に達してから、コーティング中のみオスミウムガスを注入するので結晶オスミウムの消費を節約できます。(1g使用時 100 回程度)
- ★ コーティング操作はフルオートです。SEM のスタブに取り付けた試料をホローカソード内に置き、スタートスイッチを押すだけです。
- ★ 危険な未反応オスミウムガスは排出オスミウムトラップ(活性炭)で取り除き大気汚染は在りません。活性炭の交換時期は、操作パネルで確認可能です。
- ★ 膜厚コントロールは時間・温度・電流により微調整を可能にしています。

仕様

No	項目	仕様
1	試料室サイズ	内径 120mm × 深さ 90mm。硬質ガラス製。
2	電極	アノード: 直径 116mm。カソード: 内径 104mm × 深さ 37mm。
3	試料ステージ	直径 98mm、ホローカソード内に絶縁設置。
4	処理可能試料サイズ	直径 95mm × 試料台を含めた高さ 45mm。
5	高圧発生装置	DC850V 可変、(負荷電流 max25mA) デジタル電流計指示。
6	真空排気系	30L/min フッ素オイル専用ロータリポンプ、NW25 フレキホース(1m)で接続。排出オスミウムガストラップ付属。
7	到達真空度	3Pa 以下
8	オスミウムガス注入	プログラム制御により高圧印加と連動して注入。
9	ガス導入	スウェージロック 1/4" 接続。アルゴンまたは空気を使用。ニードルバルブ調整。
10	OsO ₄ 使用量	1gアンプル 1 本で約 100 回
11	適応アンプルサイズ	太さφ12.8mm以内。 寸胴タイプ高さ60mm以下、アンプルタイプ高さ65mm以下。
12	装置サイズ	本体=幅 473mm × 奥行き 400mm × 高さ 360mm、25kg。RP=幅 120mm × 長さ 290mm × 高さ 250mm、11Kg。
13	設置面積	500mm × 500mm、卓上型(1m以下)。RP床設置。
14	電源	AC100V,15A 単相、アース線付 3 芯プラグ使用。
15	二か国語表示	日本語/英語 表示切替機能付き。
16	オプション	アンプル交換室ダクトポート、増設連結型オスミウムトラップ ロータリーポンプBOX、専用ドラフトフード、厚膜制御用プログラム